

## 日立イオンミリング装置

### IM4000PLUS

#### Hitachi Ion Milling System IM4000Plus

#### ◎ 特長

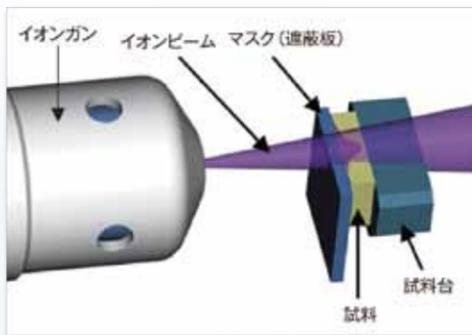
- 断面・平面ミリングに対応したハイブリッドタイプ
- 断面ミリングの高スループット化を実現  
( $> 500 \mu\text{m}/\text{h}$  at 6 kV<sup>\*1</sup>)
- 平面ミリング(フラットミリング<sup>®</sup>)による広領域加工を実現

\*1 マスクエッジからSiを100  $\mu\text{m}$ 突出させて1時間加工したときの最大深さ  
フラットミリング<sup>®</sup>は、日本国内における日立ハイテクノロジーズの登録商標です。

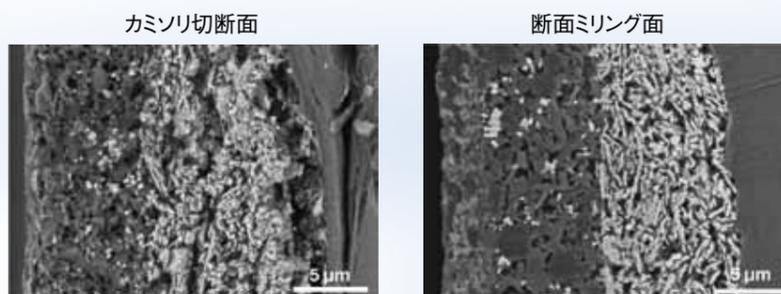


日立イオンミリング装置IM4000PLUS

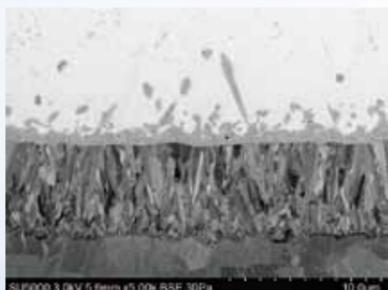
#### ◎ 断面ミリング



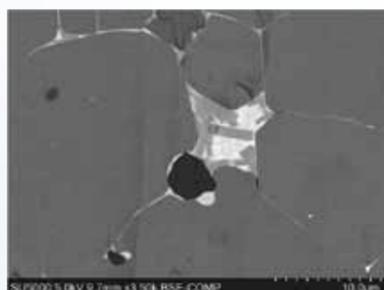
断面ミリング加工模式図



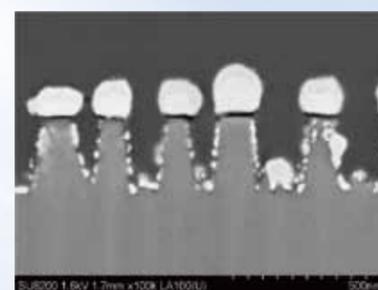
試料：感熱紙



試料：鉛フリーはんだ

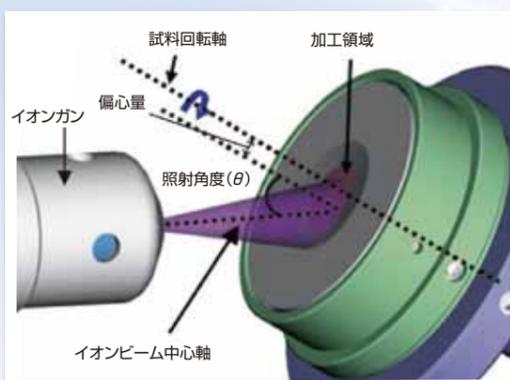


試料：Nd磁石

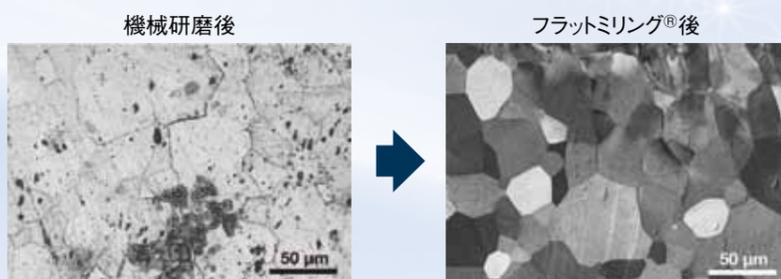


試料：ナノピラー  
試料ご提供：東京工業大学 吉野 雅彦 教授

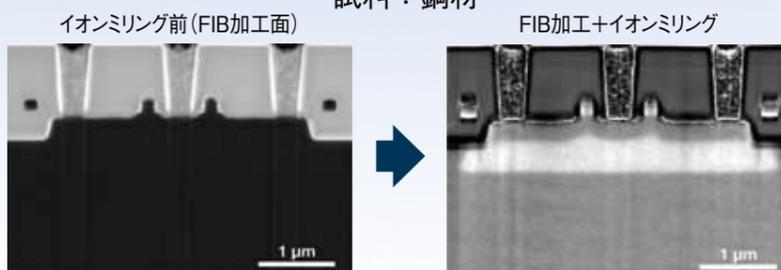
#### ◎ フラットミリング<sup>®</sup>



フラットミリング<sup>®</sup>加工模式図



試料：鋼材



試料：SRAM